

Влияние полей случайно расположенных в кристалле полупроводника заряженных центров на электронную структуру нейтральных акцепторов и поляризацию люминесценции при переходах <зона проводимости>–акцептор

© Е.Б. Осипов, О.В. Воронов, Н.О. Сорокина, В.Б. Борисов

Череповецкий государственный университет,
Череповец, Россия

(Получена 30 декабря 1997 г. Принята к печати 4 ноября 1998 г.)

Случайные поля в кристаллах, создаваемые заряженными примесями и другими дефектами, дают дополнительное расщепление уровней акцепторов, которое, в силу хаотичности направления этих полей, приводит к уменьшению степени поляризации люминесценции в условиях одноосной деформации полупроводника. Вместо обычного описания деполяризации излучения методом эффективной температуры, в работе предлагается модель учета влияния кулоновского поля случайно расположенных заряженных центров на основное состояние акцептора в поле внешней одноосной деформации полупроводника. Сопоставление рассчитанных в данной модели поляризационных характеристик люминесценции при давлении вдоль оси [100] с экспериментальными данными при низких температурах позволяет оценить концентрацию заряженных центров.

Внешняя одноосная деформация вызывает расщепление четырехкратно вырожденных уровней акцепторов в полупроводниках [1]. В условиях неодинакового температурного заселения расщепленных подуровней это приводит к поляризации люминесценции при переходах <зона проводимости>–акцептор. Естественно, поляризация такой люминесценции падает с ростом температуры. Случайные поля в кристаллах, создаваемые как заряженными примесями в компенсированных полупроводниках, так и другими дефектами, дают дополнительные расщепления, которые в силу хаотичности направления этих полей также приводят к уменьшению степени поляризации излучения. Наиболее сильное действие случайных полей должно проявиться в условиях, когда величины создаваемых ими расщеплений в среднем сравнимы с расщеплением, создаваемым одноосной деформацией и средней энергией теплового движения kT .

Деполяризацию излучения под действием случайных полей обычно описывают путем введения эффективной температуры, на несколько градусов превышающей температуру эксперимента [2]. Законность такой процедуры, однако, является спорной. Дело в том, что заселенность дырок в невырожденном полупроводнике по уровням акцепторов с фиксированным расщеплением в поле одноосной деформации определяется экспоненциальным больцмановским множителем, который проявляется в интегральной поляризации люминесценции. В случае распределения центров по величинам дополнительных случайных расщеплений такой простой экспоненциальной зависимости интегрального поляризационного отношения от внешнего давления нет.

В работе предлагается модель описания деполяризации, в которой учтено влияние на этот эффект кулоновского поля случайно расположенных заряженных центров, оказывающих наиболее сильное воздействие на основное состояние акцептора в поле внешней одноос-

ной деформации. Сопоставление рассчитанных в данной модели поляризационных характеристик люминесценции в поле внешней деформации с экспериментальными данными позволяет оценить концентрацию заряженных центров.

Действие на акцепторный центр случайного поля (т.е. кулоновское взаимодействие заряженного примесного центра и дырки, связанной на нейтральном акцепторе) описывается оператором

$$\widehat{H}_r = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0|\mathbf{R}-\mathbf{r}'|}, \quad (1)$$

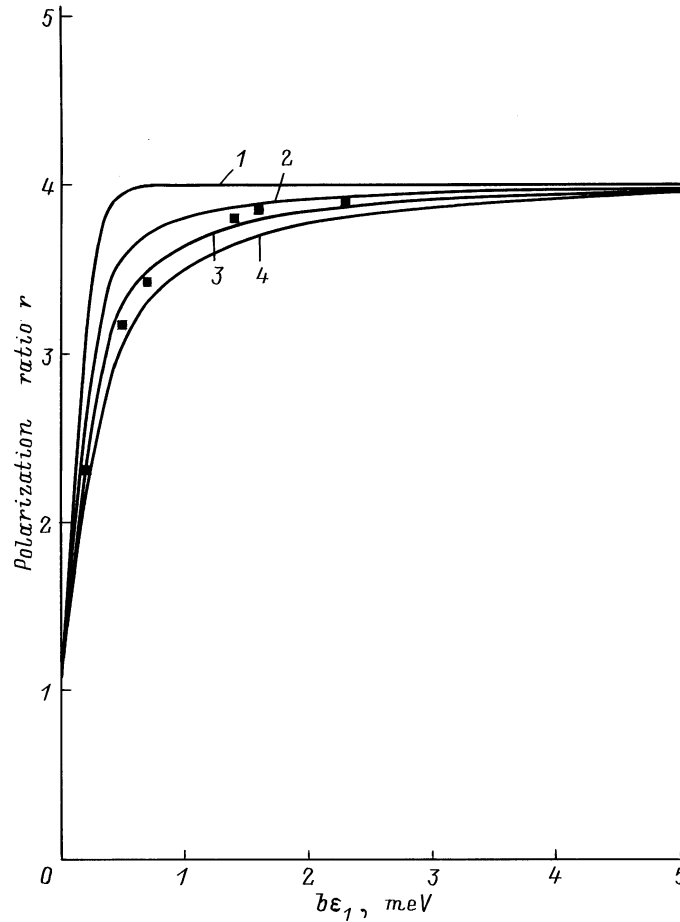
где $\mathbf{R}(R, \theta, \varphi)$ и $\mathbf{r}'(r', \theta', \varphi')$ — радиус-вектора заряженного акцептора и дырки нейтрального акцептора соответственно. Используя разложение $1/|\mathbf{R}-\mathbf{r}'|$ по сферическим функциям [3], запишем матрицу оператора энергии дырки с учетом действия на акцептор заряженного центра с координатами R, θ, ϕ в поле внешнего давления p , приложенного вдоль оси $z \parallel [001]$ в виде

$$\begin{pmatrix} A & Be^{-i\varphi} & Ce^{-2i\varphi} & 0 \\ Be^{i\varphi} & -A & 0 & Ce^{-2i\varphi} \\ Ce^{2i\varphi} & 0 & -A & -Be^{-i\varphi} \\ 0 & Ce^{2i\varphi} & -Be^{i\varphi} & A \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Матрица вычислена в приближении $R \gg r_0$, в нее не включена энергия электростатического взаимодействия, не вызывающая расщепления уровня Γ_8 , и введены следующие обозначения:

$$A = b\epsilon_1 + \frac{3}{10}D(3\cos^2\theta - 1)\frac{r_0^2}{R^3}, \quad B = D\frac{3\sqrt{3}}{5}(\sin\theta\cos\theta)\frac{r_0^2}{R^3}, \\ C = D\frac{3\sqrt{3}}{10}(\sin^2\theta)\frac{r_0^2}{R^3}, \quad D = \frac{e^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0}, \quad \epsilon_1 = \frac{p}{c_{11}-c_{12}}, \quad (3)$$

где b — константа деформационного потенциала, c_{11}, c_{12} — упругие модули кристалла, r_0 — радиус связанного состояния дырки нейтрального акцептора, ϵ —



Зависимости интегрального поляризационного отношения r от величины расщепления уровня $b\varepsilon_1$ при давлении вдоль оси [100]: 1–4 — расчет; точки — экспериментальные значения из работы [2]. Концентрация заряженных центров n , 10^{16} см^{-3} : 1 — 0, 2 — 1, 3 — 2, 4 — 3.

диэлектрическая проницаемость материала (для GaAs в численных расчетах принимаем $\varepsilon = 3.4$).

Для собственных значений гамильтониана получаем выражение

$$E_{1,2} = \pm \sqrt{(b\varepsilon_1)^2 + Db\varepsilon_1 \frac{3}{5} (3 \cos^2 \theta - 1) \frac{r_0^2}{R^3} + D^2 \frac{9}{25} \frac{r_0^4}{R^6}}. \quad (4)$$

В результате действия деформации и случайного поля акцепторный уровень расщепился на два подуровня, волновые функции которых представлены в виде разложения по базисным функциям:

$$\begin{aligned} \Psi'_{E_1, E_2} &= \frac{1}{N_{1,2}} \left(-B e^{-i\varphi} \Psi_{\frac{3}{2}, \frac{3}{2}} + (A - E_{1,2}) \Psi_{\frac{3}{2}, \frac{1}{2}} - C e^{2i\varphi} \Psi_{\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}} \right), \\ \Psi''_{E_1, E_2} &= \frac{1}{N_{1,2}} \left(-C e^{-2i\varphi} \Psi_{\frac{3}{2}, \frac{3}{2}} + (A - E_{1,2}) \Psi_{\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}} + B e^{i\varphi} \Psi_{\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}} \right), \\ N_{1,2} &= \sqrt{B^2 + C^2 + (A - E_{1,2})^2}. \end{aligned} \quad (5)$$

Функцию распределения случайных полей по величине и направлению, dW , выбираем следующим образом.

Пусть N заряженных центров в кристалле распределены квазинепрерывно с плотностью

$$\rho = \frac{N}{V} = \frac{N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3}.$$

Здесь $V = \frac{4}{3}\pi R_0^3$ — объем кристалла (шар с центром в начале системы координат, помещаемом в точку расположения нейтрального центра). Считаем, что наиболее сильное расщепление нейтрального акцептора вызывает наиболее близко расположенный к нему акцепторный центр. При этом в силу редкости расположения акцепторов действием других заряженных центров можно пренебречь.

Рассмотрим элемент сферического объема (шарового слоя) $[R, R + dR]$. Вероятность того, что в данный элемент попадет какой-либо из N заряженных центров при условии, что ни один из N центров не попадет в объем $0 \leq r \leq R$, определяется выражением

$$dW = \left(1 - \int_0^R \frac{\rho}{N} 4\pi r^2 dr \right)^N \frac{\rho}{N} 4\pi R^2 dR N.$$

Считая, что внутри шарового слоя заряженные центры с равной вероятностью заполняют любые одинаковые элементы объема $R^2 dR \sin \theta d\theta d\varphi$, получим

$$dW = \left[1 - \left(\frac{R}{R_0} \right)^3 \right]^N \frac{N}{4\pi R_0^3} 3R^2 dR \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (6)$$

Полагая число N достаточно большим, нетрудно получить, с учетом того что

$$\frac{N}{R_0^3} = \frac{4}{3} \pi n,$$

где n — концентрация заряженных центров, следующее соотношение:

$$dW = e^{-\frac{4}{3}\pi n R^3} 2\pi n R^2 \sin \theta d\theta dR. \quad (7)$$

Интегральное поляризационное отношение люминесценции определяется следующим образом:

$$r = \frac{I_{\parallel}}{I_{\perp}}. \quad (8)$$

Здесь I_{\parallel}, I_{\perp} — интенсивности излучения с вектором электрической напряженности, параллельным и перпендикулярным оси давления соответственно.

Интенсивность излучения прямо пропорциональна квадратам модулей матричных элементов переходов электронов со дна зоны проводимости на подуровни E_1 и E_2 расщепленного акцепторного уровня, а также заселенности этих подуровней. Полагая, что заселенность дырками расщепленных уровней акцепторов подчиняется распределению Больцмана, получаем следующие выражения:

$$dI_{\perp} = \Omega \left(\frac{1}{N_1^2} \frac{B^2 + \frac{(A-E_1)^2}{3} + C^2}{1 + e^{-\frac{\delta}{kT}}} + \frac{1}{N_2^2} \frac{B^2 + \frac{(A-E_2)^2}{3} + C^2}{1 + e^{-\frac{\delta}{kT}}} e^{-\frac{\delta}{kT}} \right) dW, \quad (9)$$

$$dI_{\parallel} = \Omega \left(\frac{1}{N_1^2} \frac{\frac{4}{3}(A-E_1)^2}{1 + e^{-\frac{\delta}{kT}}} + \frac{1}{N_2^2} \frac{\frac{4}{3}(A-E_2)^2}{1 + e^{-\frac{\delta}{kT}}} e^{-\frac{\delta}{kT}} \right) dW. \quad (10)$$

Здесь $\delta = E_1 - E_2$, k — постоянная Больцмана, Ω — постоянный множитель, содержащий квадрат модуля межзонного матричного элемента. Выполнив интегрирование в (9) и (10), найдем интегральные интенсивности поляризационных компонент, которые определяют поляризационное отношение (8).

Результат произведенного расчета отношения r (8) при $T = 2$ К и различных значениях концентрации заряженных примеси приведен на рисунке.

Как видно из рисунка, при значениях концентрации $n = 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ полученная зависимость хорошо согласуется с экспериментальной из работы [2]. Некоторое отклонение экспериментальных точек от рассчитанной кривой может быть объяснено проявлением электронно-колебательного взаимодействия, приводящего к ян-теллеровским искажениям нейтрального акцепторного комплекса.

Список литературы

- [1] Г.Л. Бир, Г.Е. Пикус. *Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках* (М., Наука, 1972).
- [2] Н.С. Аверкиев, З.А. Адамия, Д.И. Аладашвили, Т.К. Амиров, А.А. Гуткин, Е.Б. Осипов, В.Е. Седов. ФТП, **21**, 421 (1987).
- [3] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. *Квантовая механика. Нерелятивистская теория* (М., Наука, 1989).

Редактор Т.А. Полянская